

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成18年12月7日(2006.12.7)

【公開番号】特開2005-132751(P2005-132751A)

【公開日】平成17年5月26日(2005.5.26)

【年通号数】公開・登録公報2005-020

【出願番号】特願2003-368529(P2003-368529)

【国際特許分類】

C 07 F 7/08 (2006.01)

【F I】

C 07 F 7/08 X

【手続補正書】

【提出日】平成18年10月20日(2006.10.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項5

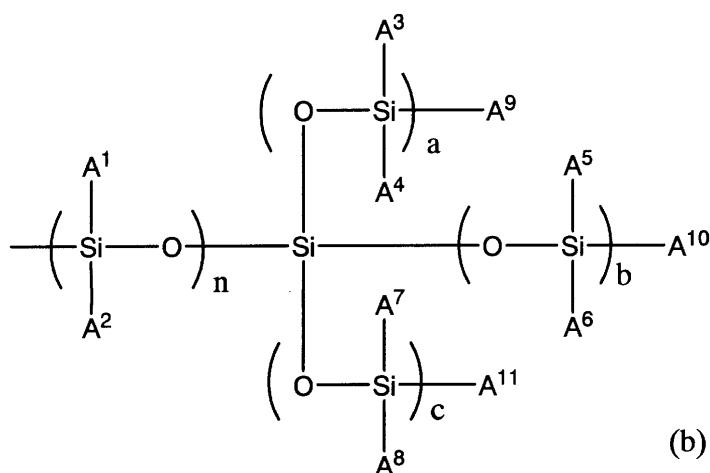
【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】

一般式(z)または(z')において、シロキサニル基(A)が下記式(b)で表される置換基である請求項3または4記載のシリコーン化合物の製造方法。

【化1】



[式(b)中、A¹ ~ A¹¹ はそれぞれが互いに独立に水素、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基のいずれかを表す。nは0~200の整数を表し、a、b、cはそれぞれが互いに独立に0~20の整数を表す。ただし n = a = b = c = 0 の場合は除く。]

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

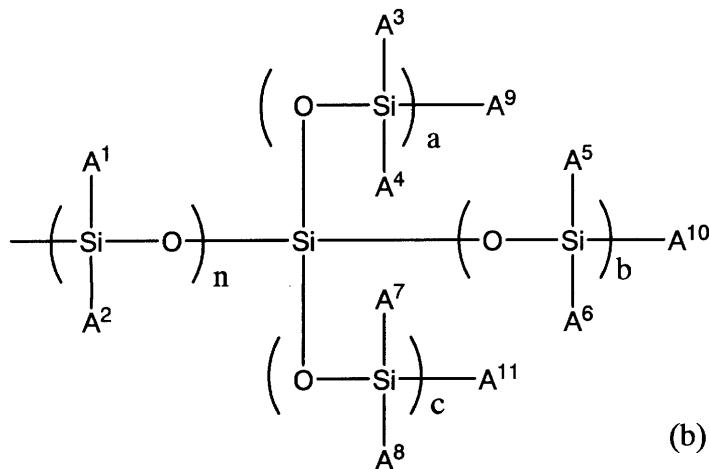
【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0031】

【化2】



[式(b)中、A¹ ~ A¹¹はそれぞれが互いに独立に水素、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基のいずれかを表す。nは0~200の整数を表し、a、b、cはそれぞれが互いに独立に0~20の整数を表す。ただしn=a=b=c=0の場合は除く。]

(6) 一般式(z)または(z')において、シロキサニル基(A)がトリス(トリメチルシロキシ)シリル基、ビス(トリメチルシロキシ)メチルシリル基、トリメチルシロキシジメチルシリル基から選ばれた置換基であることを特徴とする前記(3)または(4)記載のシリコーン化合物の製造方法。」

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

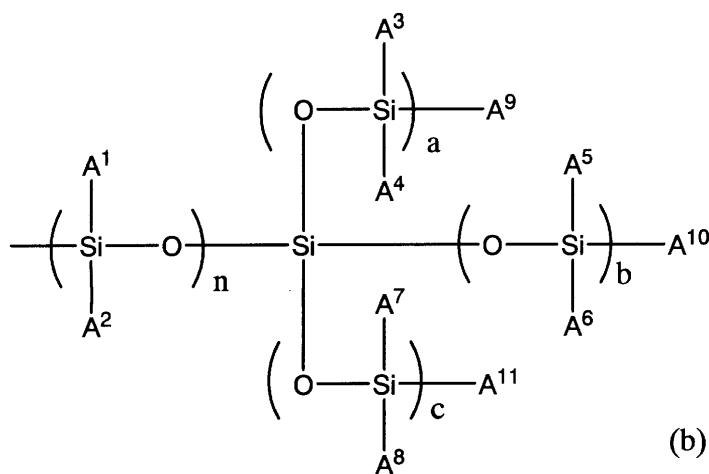
【補正対象項目名】0036

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0036】

【化3】



[式(b)中、A¹ ~ A¹¹はそれぞれが互いに独立に水素、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基のいずれかを表す。nは0~200の整数を表し、a、b、cはそれぞれが互いに独立に0~20の整数を表す。ただしn=a=b=c=0の場合は除く。]

式(b)中、A¹からA¹¹はそれぞれが独立に水素、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、ヘキシリル基、シクロヘキシリル基、2-エチルヘキシリル基、オクチル基などのアルキル基、フェニル基、ナフチル基などのアリール基などを挙げることができる。これらの中で最も好まし

いのはメチル基である。